



2026 年 5 月 21 日

各 位

会社名 リンテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 服部 真
コード番号 7966 東証プライム市場
問い合わせ先 取締役 専務執行役員
総務・人事本部長 海谷健司
(TEL. 03 - 5248 - 7711)

リンテック つくばイノベーションクリエーションセンター 開設に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下、産総研)つくばセンター中央事業所内に「リンテック つくばイノベーションクリエーションセンター」を開設することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は同拠点に先端半導体の微細回路形成に欠かせない EUV 露光機用ペリクル(防塵材料)の生産設備を導入し、研究開発および本格生産に向けた取り組みを推進してまいります。

記

【概要】

正式名称 : つくばイノベーションクリエーションセンター
開設予定 : 2026 年 6 月 1 日
所在地 : 茨城県つくば市東 1-1-1
(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくばセンター 中央事業所 内)
人員体制 : 常勤約 30 人を予定
※産総研について <https://www.aist.go.jp/>
※産総研 先端半導体研究センターについて <https://unit.aist.go.jp/sfrc/>

【設立背景】

先端半導体の微細回路形成には EUV(Extreme Ultraviolet:極端紫外線)露光機が用いられますが、露光機の性能向上に伴い、フォトマスク(回路パターンの原版)への異物の付着を防ぐペリクルは耐熱性、耐久性や透過性といった面でより高い性能が求められています。

当社グループでは以前から、CNT(カーボンナノチューブ)シートの開発を手がける米国・テキサス州の研究開発拠点と、国内の研究開発本部とが連携して CNT 製ペリクルの開発を進めてきました。その要素技術を確立した 2023 年、当社は産総研 先端半導体研究センターと、EUV 露光機用ペリクルの評価技術と半導体ミッドエンド向け製造プロセス技術の共同研究に着手し、翌年には CNT 製ペリクル膜の生産設備を開発。その後も引き続き製品開発・品質改良と、製造条件の最適化なども含めた量産プロセスの検討を並行して進めてきました。そして、このたび産総研つくばセンター中央事業所内に、当社の新たな研究開発・生産拠点として「リンテック つくばイノベーションクリエーションセンター」を開設することにしました。

同センターには、自社開発の CNT 製ペリクル膜生産設備および関連設備などを導入。まずはフルサイズのペリクルサンプル供給に着手していくとともに、検査装置や製品供給に必要な付帯設備なども今後、段階的に導入する計画です。産総研 先端半導体研究センターとの次世代半導体デバイス製造向けナノリソグラフィ要素技術に関する包括的な共同研究を継続するとともに、CNT 製ペリクルについて顧客からサンプル評価をしていただきながら、さらなる製品開発と本格生産に向けた取り組みを加速してまいります。

【業績等に与える影響について】

今期以降の連結業績に与える影響につきましては未定のため、開示できる段階になりましたら速やかに開示いたします。

以 上